WELTORGANISATION FÜR GEISTIGES EIGENTUM Internationales Büro



INTERNATIONALE ANMELDUNG VERÖFFENTLICHT NACH DEM VERTRAG ÜBER DIE INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT AUF DEM GEBIET DES PATENTWESENS (PCT)

(51) Internationale Patentklassifikation 4:

H05K 3/34, 3/02

(11) Internationale Veröffentlichungsmunner: WO 86/06243

(43) Internationales

Veröffentlichungsdatum:

23. Oktober 1986 (23.10.86)

(21) Internationales Aktenzeichen:

PCT/DE86/00165

A1

(22) Internationales Anmeldedatum: 15. April 1986 (15.04.86)

(31) Prioritätsaktenzeichen:

P 35 14 093.3

(32) Prioritätsdatum:

16. April 1985 (16.04.85)

(33) Prioritătsland:

(71)(72) Anmelder und Erfinder: EIDENBERG, Kaspar [DE/DE]; Barbarastrasse 18, D-5241 Gebhardshain (DE).

(74) Anwalt: BERKENFELD, Helmut; An der Schanz 2, D-5000 Köin 60 (DE).

(81) Bestimmungsstaaten: AT (europäisches Patent), BE (europäisches Patent), CH (europäisches Patent), DE (europāisches Patent), FR (europāisches Patent), GB (europäisches Patent), IT (europäisches Patent), LU (europäisches Patent), NL (europäisches Patent), SE (europaisches Patent), US.

Veröffentlicht

Mit internationalem Recherchenbericht.

Vor Ablauf der für Änderungen der Ansprüche zugelassenen Frist. Veröffentlichung wird wiederholt falls Än-

derungen eintreffen.

(54) Title: PROCESS FOR THE CLOSING UP OF DRILL HOLES PROVIDED FOR IN A PRINTED CIRCUIT BOARD

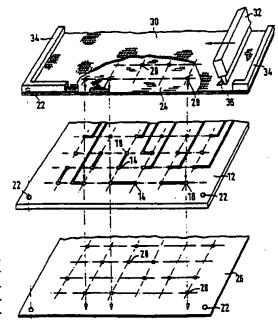
(54) Bezeichnung: VERFAHREN ZUM VERSCHLIESSEN VON IN EINER LEITERPLATTE VORGESEHENEN BOHRUNGEN

57) Abstract

Closing up of passive drill holes (14, 18) provided for in a printed circuit board (12). To this effect a mask (24, 26) with creen (30) is laid on the printed circuit board that has been drilled hrough. At the points corresponding to the drill holes (14) that are to be filled, the mask (24, 26) has holes (28). With a doctor blade 32) solder fill varnish (36) is pressed through the holes in the screen (30) and in the mask (24) into the drill holes (18) as is done in the screen printing process. This pressing of the solder fill varnish into the drill holes (18) can be reinforced through the application of negative pressure from below on the printed circuit board (12).

(57) Zusammenfassung

Verschliessen der in einer Leiterplatte (12) vorgesehenen passiven Bohrungen (14, 18). Hierzu wird auf die gebohrte Leiterplatte eine Maske (24, 26) mit einem Sieb (30) aufgelegt. An den Stellen der zu verschliessenden Bohrungen (14) weist die Maske (24, 26) Locher (28) auf. Mit einem Rakel (32) wird wie im Siebdruckverfahren Lötstoplack (36) durch das Sieb (30) und die in der Maske (24) vorgesehenen Löcher (28) in die Bohrungen (18) hineingedrückt. Dieses Hineindrücken des Lötstoplackes in die Bohrungen (18) kann durch Anlegen eines Unterdruckes an die Unterseite der Leiterplatte (12) verstärkt werden.



LEDIGLICH ZUR INFORMATION

Code, die zur Identifizierung von PCT-Vertragsstaaten auf den Kopfbögen der Schriften, die internationale Anmeldungen gemäss dem PCT veröffentlichen.

AT	Österreich	FR	Prankreich	ML	Mali
ΑŪ	Australien	GA	Gabun	MR	Mauritanien
BB	Barbados	GB	Vereinistes Königreich	MW	Malawi
BE	Belgien	HU	Unnam	NL	Niederlande
BG	Bulgarien	π	Italien	NO	Norwegen
		ĴР	Japan	RO	Rumānien
BR	Brasilien		Demokratische Volksrepublik Korea	SD	Sudan
Œ	Zentrale Afrikanische Republik	KP			
CG	Kongo	KR	Republik Korea	SE	Schweden
CH	Schweiz	LI	Liechtenstein	SN	Senegal
CM	Kamerun	LX	Sri Lenka	SU	Soviet Union
DE	Deutschland, Bundesrepublik	LÜ	Luxemburg	TD	Tschad
DK	Dänemark	MC	Monaco	TG	Toreo
	-	MG	Madagaskar	US	Vereinigte Staaten von Amerika
П	Finnland	1710		-	· or a trading a service . On 1 street ser
			•		

Verfahren zum Verschließen von in einer Leiterplatte vorgesehenen Bohrungen

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Verschließen von in einer Leiterplatte vorgesehenen Bohrungen mit Auftragen eines Lötstoplackes auf mindestens eine Seite der Leiterplatte.

Leiterplatten, auf denen gedruckte Schaltungen ausgebildet werden, sind bekannt. Diese Leiterplatten weisen aktive und passive Bohrungen auf. In die aktiven Bohrungen werden die Bauelemente eingesetzt. Diese werden mit Lot elektrisch angeschlossen. Dadurch werden die aktiven Bohrungen vakuumdicht verschlossen. Die passiven Bohrungen dienen zum elektrischen Verbinden der einen mit der anderen Seite der Leiterplatte. Man bezeichnet sie auch als Umsteiger von der einen zur nächsten Ebene. Hierzu bleiben die passiven Bohrungen offen. Sie werden nicht mit Lot verschlossen. Die elektrische Verbindung von der einen zur anderen Seite der Leiterplatte erfolgt dabei zum Beispiel mit der sogenannten Durchmetallisierung.

Die fertigen bestückten Leiterplatten werden auf verschiedene Weise geprüft. Bei einem modernen Prüfverfahren werden die Leiterplatten mit Unterdruck in einen Adapter gezogen und durch den Unterdruck in diesem gehalten. Dieser Unterdruck wird durch die offen gebliebenen passiven Bohrungen zerstört. Zum Anwenden dieses Prüfverfahrens müssen daher auch die passiven Bohrungen geschlossen werden.

Man hat versucht, die passiven Bohrungen auf einer Lötwelle

zu schließen. Dabei können sich jedoch zwischen einem Lötauge und einer angrenzenden Leiterbahn kleine Zinnperlen
festsetzen. Dadurch kann unter einem Bauelement ein Kurzschluß entstehen. Dieses Verfahren hat daher starke Nachteile.

Man hat weiter versucht, die Bohrungen mit einer Lötstopmaske aus einer Fotopolymerschicht geschlossen zu halten.
Hierzu beläßt man diese Schicht in gespanntem Zustand über
den Bohrungen. Unter Lötstopmaske ist dabei eine Schicht
aus einem sogenannten Lötstoplack zu verstehen. Ein Lötstoplack ist ein Lack, der nach einem bestimmten Muster
auf eine Leiterplatte aufgebracht wird. Er verhindert das
Anhaften von Lot. Das Verschließen der Bohrungen mit einer
Fotopolymerschicht ist jedoch ein sehr teures Verfahren.

Von diesem Stand der Technik ausgehend liegt der Erfindung die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren zum Verschließen von Bohrungen in einer Leiterplatte zu finden, das sich sicher und kostengünstig durchführen läßt. Die Lösung für diese Aufgabe ergibt sich nach der Erfindung dadurch, daß die Bohrungen mit einem Pfropfen aus dem schon genannten Lötstoplack verschlossen werden. Zweckmäßig wird dieser Lötstoplack im Siebdruckverfahren aufgebracht. Im Siebdruckverfahren besitzt man große Erfahrung, und es läßt sich kostengünstig durchführen.

In der praktischen Verwirklichung der Erfindung ist vorgesehen, daß eine erste Maske mit einem der Zahl und der Lage der zu verschließenden Bohrungen entsprechenden Lochmuster und einem Sieb auf der von der Leiterplatte abgewandten Seite auf diese aufgelegt, der Lötstoplack aufgebracht und mit einem Rakel in die Bohrungen hineingedrückt wird. Dabei sollte der Durchmesser der in der ersten Maske vorgesehenen Löcher etwas über dem Durchmesser der zu verschließenden Bohrungen liegen. Das für die Pfropfen ge-

wünschte oder erforderliche Volumen läßt sich mit der Stärke der ersten Maske einregeln. Bei ansteigender Stärke steigt das Volumen der Pfropfen und umgekehrt.

Die Schnelligkeit und das Ausmaß, mit denen der Lötstoplack in die zu verschließenden Bohrungen eindringt, läßt
sich erfindungsgemäß durch Anlegen eines Unterdruckes auf
die andere Seite der Leiterplatte erhöhen. Hierzu wird im
einzelnen vorgeschlagen, daß eine zweite Maske mit einem
der Zahl und der Lage der zu verschließenden Bohrungen
entsprechenden Lochmuster auf die andere Seite der Leiterplatte aufgelegt und ein Vakuum angelegt wird und damit das
Hineindrücken des Lötstoplackes in die Bohrungen von der
einen Seite unterstützt wird.

Das für den erfindungsgemäßen Siebdruck verwendete und auf die erste Maske aufgebrachte Sieb muß sehr grobmaschig sein. Der Lötstoplack soll weiter eine hohe Thixotropie aufweisen. Damit wird sichergestellt, daß er ausreichend schnell und tief in die zu verschließenden Bohrungen eindringt. Die Menge des Lötstoplackes wird so eingestellt, daß er mindestens die halbe Tiefe der Bohrung ausfüllt. In einer Weiterbildung kann das erfindungsgemäße Verfahren auch von den beiden Seiten der Leiterplatte aus angewendet werden. Hierbei werden die Bohrungen von jeder Seite zur Hälfte gefüllt und damit vakuumdicht verschlossen.

Am Beispiel der in der Zeichnung gezeigten Ausführungsform wird das erfindungsgemäße Verfahren nun weiter beschrieben. In der Zeichnung ist:

- Fig. 1 eine perspektivische Teilansicht einer fertigen Leiterplatte,
- Fig. 2 eine auseinandergezogene perspektivische Darstellung

Ċ

von oben auf sie aufzulegenden ersten Maske mit Sieb und Rakel und der von unten an sie anzulegenden zweiten Maske,

- Fig. 3 eine Teildarstellung, teilweise im Schnitt, durch die Leiterplatte während ihrer Herstellung beim Aufbringen des Lötstoplackes,
- Fig. 4 eine Darstellung entsprechend Fig. 3 mit zusätzlicher Verwendung der zweiten Maske auf der Unterseite der Leiterplatte und Anlegen eines Vakuums und
- Fig. 5 in vergrößertem Maßstab die Darstellung eines Gebietes aus Fig. 5 zur besseren Verdeutlichung der Verfahrensvorgänge.
- Fig. 1 zeigt vereinfacht eine Leiterplatte 12 mit ihren offen bleibenden Bohrungen 14. In diese werden die Anschlüsse
 der schematisch dargestellten Bauteile 16 eingesteckt. Fig.
 1 zeigt weiter die zu verschließenden Bohrungen 18. Zwischen
 diesen verlaufen die Leiterbahnen 20. Die Bohrungen 18 sind
 durchmetallisiert. Damit kann der Strom von einer Leiterbahn
 auf der Oberseite zu einer Leiterbahn auf der Unterseite der
 Leiterplatte 12 fließen. In den Ecken der Leiterplatte 12
 sind noch Paßbohrungen 22 vorgesehen. Mit diesen wird sie
 bei ihrer Fertigung in der richtigen Lage gehalten.
- Fig. 2 zeigt die gleiche Leiterplatte 12 während ihrer Herstellung. Sämtliche Bohrungen sind noch offen. Über der Leiterplatte 12 befindet sich die obere erste Maske 24. Unter der Leiterplatte 12 befindet sich die wahlweise anzulegende untere zweite Maske 26. Beide Masken 24 und 26 weisen dort, wo sich die zu verschließenden Bohrungen 18 befinden, Löcher 28 auf. Unmittelbar auf der oberen Maske 24 befindet sich das Sieb 30. Fig. 2 zeigt weiter den Rakel 32. Er ist innerhalb des Rahmens 34 verschiebbar. Der Lötstoplack der

durch den Rakel 32 in die zu verschließenden Bohrungen 18 gedrückt wird, ist bei 36 angedeutet. In der Leiterplatte 12 sind sowohl die Bohrungen 14 als auch die Bohrungen 18 noch offen.

Fig. 3 zeigt die Ausübung des Verfahrens. Die Leiterplatte 12 liegt auf einer Unterlage 38. Auf der Leiterplatte liegen die obere Maske 24 mit den Löchern 28 und das Sieb 30 auf. Eingezeichnet ist weiter die Durchmetallisierung 40 sowohl der offenen Bohrungen 14 als auch der zu verschlie-Benden Bohrungen 18. Im Betrieb wird der Rakel 32 in Richtung des eingezeichneten Pfeiles über das Sieb 30 geschoben. Dabei drückt er den vor ihm befindlichen Lötstoplack 36 durch die Maschen des Siebes 30 und durch die in der oberen Maske 24 vorgesehenen Löcher 28. Diese befinden sich genau über den zu verschließenden Bohrungen 18. Wie dies für die rechts liegende Bohrung 18 angedeutet ist, ist ein Pfropfen 42 aus Lötstoplack in diese hineingedrückt worden. Er füllt etwa die halbe Höhe der Bohrung 18 auf. In der weiter links liegenden Bohrung 18, über der sich gerade der Lötstoplack 36 befindet, hat der Pfropfen 42 noch nicht diese Länge erreicht. Bei Verwendung eines thixotropen Lötstoplackes ist dieser beim Hineindrücken in die Bohrung 18 noch flüssig.Dies erleichtert sein Eindringen in die Bohrung 18. Durch den durch den Rakel 32 ausgeübten Druck werden die obere Schablone 28 mit dem Sieb 30 vor und hinter dem Rakel 32 etwas angehoben. Nur unter dem Rakel 32 liegen sie unmittelbar auf der Leiterplatte 12 auf.

Falls Pfropfen 42 mit einer Länge von etwa der halben Höhe der Leiterplatte 12 nicht zum Verschließen der Bohrung n 18 ausreichen, kann das Verfahren, wie vorstehend angegeben, auch von der anderen Seite, das heißt von unten, ausgeführt werden. Ebenso läßt sich das Eindringen der Pfropfen 42 in die Bohrungen 18 durch das Anlegen eines Unter-

Dies zeigt Fig. 4. Die Oberseite der Unterlage 38 ist gerieft. Kanäle 44 treten durch die Unterlage 38 durch. Die bereits erwähnte zweite Maske 26 liegt auf der gerieften Oberseite der Unterlage 38 auf. An den zu verschließenden Bohrungen 18 weist sie Löcher 28 auf. Die Kanäle 44 sind an eine Unterdruckquelle angeschlossen. Über die Riefen in der Oberseite der Unterlage 38 pflanzt sich dieser bis zu den Löchern 28 in der zweiten Maske 26 und damit bis in die zu verschließenden Bohrungen 18 fort. Wenn nun der Rakel 32 über das Sieb 30 fährt und den Lötstoplack 36 in die Bohrungen 18 drückt, werden die sich bildenden Pfropfen 42 zusätzlich durch den Unterdruck nach unten gezogen. Man erkennt, daß der in Fig. 4 rechts befindliche Pfropfen 42 länger als sein Gegenstück in Fig. 3 ist.

Fig. 5 zeigt in größerem Maßstab den Teilbereich aus Fig. 4, der sich am und etwas links vom Rakel 32 befindet. Die sich auf diesen Teil beziehende Beschreibung von Fig. 4 gilt auch für Fig. 5.

Die Abmessungen und die räumliche Zuordnung der verschiedenen Teile in der Skizze sind nur schematisch und nicht maßctäblich zu verstehen

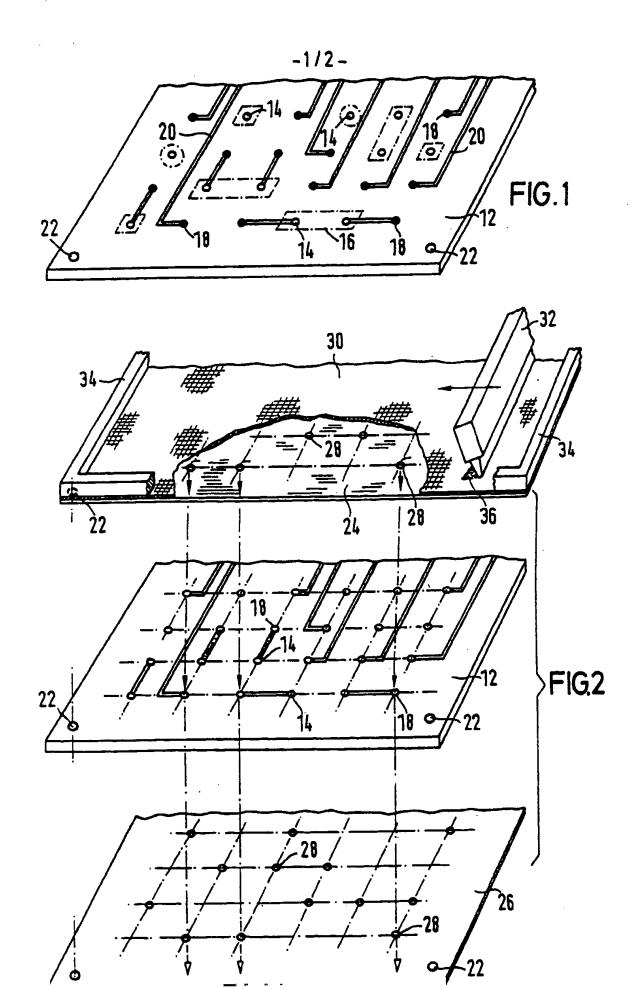
- 7 -

Patentansprüche

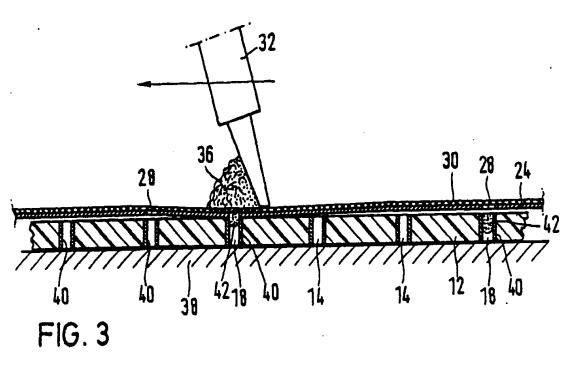
- 1. Verfahren zum Verschließen von in einer Leiterplatte vorgesehenen Bohrungen mit Auftragen eines Lötstoplackes auf mindestens eine Seite der Leiterplatte, dadurch gekennzeichnet, daß die Bohrungen mit einem Pfropfen aus Lötstoplack verschlossen werden.
- 2. Verfahren nach Anspruch I, dadurch gekennzeichnet, daß der Lötstoplack im Siebdruckverfahren aufgebracht wird.
- 3. Verfahren nach Anspruch 1 und 2, dadurch gekennzeichnet, daß eine erste Maske mit einem der Zahl und der Lage der zu verschließenden Bohrungen entsprechenden Lochmuster und einem Sieb auf der von der Leiterplatte abgewandten Seite auf diese aufgelegt, der Lötstoplack aufgebracht und mit einem Rakel in die Bohrungen hineingedrückt wird.
- 4. Verfahren nach Anspruch 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, daß der Durchmesser der in der ersten Maske vorgesehenen Löcher etwas über dem Durchmesser der zu verschließenden Bohrungen liegt.
- 5. Verfahren nach Anspruch l bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß die Stärke der ersten Maske nach Maßgabe des für die Pfropfen gewünschten Volumens ausgewählt wird.
- 6. Verfahren nach Anspruch 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß eine zweite Maske mit einem der Zahl und der Lage der zu verschließenden Bohrungen entsprechenden Lochmuster auf die andere Seite der Leiterplatte aufgelegt und ein Vakuum angelegt wird und damit das Hineindrücken des Lötstoplackes in die Bohrungen von der einen Seite un-

terstützt wird.

- 7. Verfahren nach Anspruch 1 bis 6, gekennzeichnet durch die Verwendung eines Lötstoplackes mit einer hohen Thixotropie.
- 8. Verfahren nach Anspruch 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß es auf den beiden Seiten der Leiterplatte angewendet wird.



-2/2-



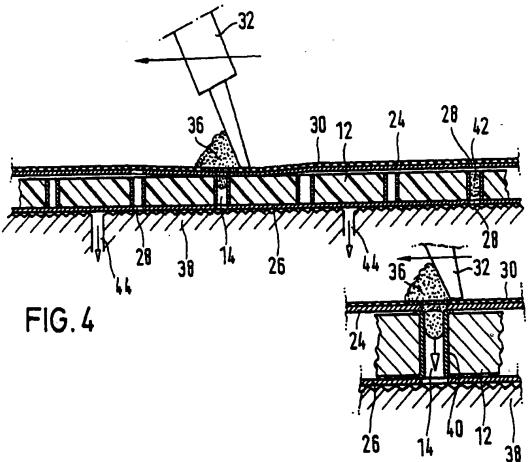


FIG. 5

INTERNATI NAL SEARCH REP RT

International Application No PCT/DE 86/00165

	I. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (it several classification symbols apply, indicate all) *					
1. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER (if Several cassification symbols apply, industrial According to International Patent Classification (IPC) or to both National Classification and IPC						
Int. Cl. ⁴ : H 05 K 3/34; H 05 K 3/02						
IL FRELE	S SEARCHED					
		Minimum Decumer				
Classifica	tion System		Cleanification Symbols			
Int. C	Int. Cl. ⁴ H 05 K					
		Documentation Searched other to the Extent that such Decuments	han Minimum Documentation are included in the Fields Searched ²			
- DOC:	UMENTS COME	DERED TO BE RELEVANT				
Category *	Citation of	Decument, " with Indication, where appr	opriets, of the relevant passages 12	Relevant to Claim No. 13		
X	SPATIA	618 (COMPAGNIE D'INFORMA LLE ET AERONAUTIQUE) 8 M page 5, line 13; figure 1	ATIQUE MILITAIRE larch 1985, see page 4,	1,2		
	10.	page 3, Ame 13, 25-11		3,5		
A		-				
A	US, A, 4478882 (ITALTEL SOCIETA ITALIANA TELECOMMUNICAZIONI SPA) 23 October 1984, see column 2, line 45 - column 3, line 2, figure 1			1,6		
A	US, A, 4323593 (MATSUSHITA ELECTRIC IND. CO.) 6 April 1982, see example 1; column 4, lines 44-65; figure 1			3,4		
		·				
"T" later decument published after the international filing do priority date and not in conflict with the application considered to be of particular relevance "E" seriler document but published on or after the international filing date. "L" document which may throw doubts on priority claim(a) or which is chied to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified) "O" document referring to an eral disclosure, use, exhibition or other means. "P" decument published prior to the international filing date but letter then the priority date claimed. "I" later decument published after the international filing date but invention and not in conflict with the application citation considered to endorstand the priority date claimed. """ later decument published after the international filing date but invention and not in conflict with the application citation to endorstand the priority date claimed invention to considered novel or cannot be considered novel or cannot be considered invention and inventive at inventive and particular relevance; the claimed invention and inventive at an inventiv						
IV. CERTIFICATION						
Date of the Actual Completion of the International Search Date of Mailing of this International Search Report						
28 July 1986 (28,07.86) 22 August 1986 (22,08.86)				36)		
international Searching Authority EUROPEAN PAT ENT OFFICE Signature of Authorized Officer				_		

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 1905)

ANNEX TO THE INTERNATIONAL SEARCH REPORT ON

INTERNATIONAL APPLICATION NO.

PCT/DE 86/00165 (SA 12881)

This Annex lists the patent family members relating to the patent documents cited in the above-mentioned international search report. The members are as contained in the European Patent Office EDP file on 06/08/86

The European Patent Office is in no way liable for these particulars which are merely given for the purpose of information.

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member(s)	Publication date
FR-A- 2551618	08/03/85	None	
US-A- 4478882	23/10/84	None	
US-A- 4323593	06/04/82	JP-A- 55138294	28/10/80

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

internationales Aktenzeichen

PCT/DE 86/00165

I. KLASSIFIKATION DES ANWELDUNGSGEGENSTANDS (bei mehreren Klassifikationssymbolen and and angulations					
Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPC) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPC					
Int. Cl 4 H 05 K 3/34; H 05 K 3/02					
II. RECHERCHIERTE SACHGEBIETE					
	Recherchierter N	Aindestprüfstoff ⁷			
Klassifik	ationssystem	Klassifikationssymbole			
int. Cl.4	н 05 к				
	Recherchierte nicht zum Mindestprüfstoff g unter die recherchierte	shörende Veräffentlichungen, soweit diese en Sachgebiere fallen ⁸			
IIL EINS	CHLÄGIGE VERÖFFENTLICHUNGEN ⁹	2	Betr. Anspruch Nr. 13		
Art*	Kennzeichnung der Veröffentlichung 11, soweit erforderlich	h unter Angabe der maßgeblichen Teilez-	Betr. Ansproch IV.		
X	FR, A, 2551618 (COMPAGNIE D'I SPATIALE ET AERONAUTIQUE) Seite 4, Zeile 16 - Seite Abbildung 1	8. Marz 1985, siene	1,2		
A			3,5		
A	US, A, 4478882 (ITALTEL SOCIETA ITALIANA TELECOMMUNICAZIONI SPA) 23. Oktober 1984, siehe Spalte 2, Zeile 45 - Spalte 3, Zeile 2, Abbildung 1				
A	US, A, 4323593 (MATSUSHITA ELECTRIC IND.CO.) 6. April 1982, siehe Beispiel 1; Spalte 4, Zeilen 44-65; Abbidlung 1				
* Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen 10: "A" Veroffentlichung, die den aligemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutstam anzusehen ist ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zu Verständnis des der Er findung zugrundeliegenden Prinzitonalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zu Verständnis des der Er findung zugrundeliegenden Prinzitonalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zu Verständnis des der Er findung zugrundeliegenden Prinzitonalen Prinzitonalen Prinzitonalen Prinzitonalen veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruch keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruch keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruch keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruch keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruch keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruch keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruch keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruch keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruch keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruch keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruch keit beruhend betrachtet werden "Y" Veröffentlichtung von besonderer Bedeutung; die beanspruch					
anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgefuhrt) anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgefuhrt) anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgefuhrt) "O" Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Berutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht "P" Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffent- licht worden ist "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruch- te Erfrindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit be- ruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist "A" Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patantfamilie ist					
IV. BESCHEINIGUNG					
Datum des Abschlusses der internationalen Recherche Absendedatum des internationalen Recherchenberichts					
28.					
Interr	Internationale Recherchenbehorde Unterschrift der bevollmachtigten Bedlemsteten M. WAH INCL				
	Europäisches Patentamt				

ANHANG ZUM INTERNATIONALEN RECHERCHENBERICHT UBER DIE

INTERNATIONALE PATENTANMELDUNG NR. PCT/DE 86/00165 (SA 12881)

In diesem Anhang sind die Mitglieder der Patentfamilien der im obengenannten internationalen Recherchenbericht angeführten Patentdokumente angegeben. Die Angaben über die Familienmitglieder entsprechen dem Stand der Datei des Europäischen Patentamts am 06/08/86

Diese Angaben dienen nur zur Unterrichtung und erfolgen ohne Gewähr.

Im Recherchenbe- richt angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffent- lichung	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffent- Lichung
FR-A- 2551618	08/03/85	Keine	
US-A- 4478882	23/10/84	Keine	
US-A- 4323593	06/04/82	JP-A- 55138294	28/10/80